## (12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE

(15) Information de correction:

Version corrigée no 1 (W1 B1) Bibliographie code(s) INID 73

(48) Corrigendum publié le: **25.03.2009 Bulletin 2009/13** 

(45) Date de publication et mention de la délivrance du brevet: 29.10.2008 Bulletin 2008/44

(21) Numéro de dépôt: 99903756.7

(22) Date de dépôt: 15.02.1999

(51) Int Cl.: **H01L 21/28** (2006.01) **H01L 29/49** (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international: PCT/FR1999/000330

(87) Numéro de publication internationale:
WO 1999/043024 (26.08.1999 Gazette 1999/34)

## (54) PROCEDE POUR LIMITER L'INTERDIFFUSION DANS UN DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR A GRILLE COMPOSITE SI/SIGE

VERFAHREN ZUR VERMINDERUNG DER INTERDIFFUSION IN EINEM HALBLEITERBAUELEMENT MIT SI/SIGE VERBINDUNGS-GATTER

METHOD FOR LIMITING INTERNAL DIFFUSION IN A SEMICONDUCTOR DEVICE WITH COMPOSITE SI/SIGE GATE

(84) Etats contractants désignés:

BE DE GB IT NL

(30) Priorité: 19.02.1998 FR 9802026

(43) Date de publication de la demande: **02.02.2000 Bulletin 2000/05** 

(73) Titulaire: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 75015 Paris (FR)

(72) Inventeurs:

 BENSAHEL, Daniel F-38000 Grenoble (FR)

 CAMPIDELLI, Yves F-38000 Grenoble (FR)

MARTIN, François
F-38000 Grenoble (FR)

 HERNANDEZ, Caroline F-38000 Grenoble (FR)

(74) Mandataire: Casalonga, Axel Bureau Casalonga & Josse Bayerstrasse 71/73 80335 München (DE) (56) Documents cités:

US-A- 5 521 108 US-A- 5 567 638

- KISTLER N ET AL: "SYMMETRIC CMOS IN FULLY-DEPLETED SILICON-ON-INSULATOR USING P+- POLYCRYSTALLINE SI-GE GATE ELECTRODES" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING, WASHINGTON, DEC. 5 - 8, 1993,5 décembre 1993, pages 727-730, XP000481716 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS cité dans la demande
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 401 (E-1404), 27 juillet 1993 -& JP 05 075136 A (OKI ELECTRIC IND CO LTD), 26 mars 1993
- JIN Z ET AL: "LOW-TEMPERATURE ANNEALING OF POLYCRYSTALLINE SI1-XGEX AFTER DOPANT IMPLANTATION" IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, vol. 44, no. 11, novembre 1997, pages 1958-1963, XP000722070
- HELLBERG P -E ET AL: "WORK FUNCTION OF BORON-DOPED POLYCRYSTALLINE SIXGE1-X FILMS" IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, vol. 18, no. 9, septembre 1997, pages 456-458, XP000696525

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).